02;06.3;07;11;12

Энергетические переходы в халькопиритных пленках Culn(Te,Se)₂ вблизи фундаментального края поглощения

© В.В. Киндяк, А.С. Киндяк, Я.И. Латушко

Институт физики твердого тела и полупроводников АН Беларуси, Минск

Поступило в Редакцию 10 января 1997 г.

Исследована структура краевого поглощения в тонких халькопиритных пленках $CuIn(Te,Se)_2$. Идентифицированы энергетические переходы, обусловленные расщеплением валентной зоны под действием тетрагонального поля кристаллической решетки и спин-орбитального взаимодействия. Установлены их концентрационные зависимости.

Тонкопленочные структуры на основе халькопиритных соединений ${\rm CuInSe_2}$ и ${\rm CuInTe_2}$ обладают высоким коэффициентом поглощения ($\alpha\approx10^4-10^5\,{\rm cm^{-1}}$) и оптимальной шириной запрещенной зоны ($E_g\approx1\,{\rm 3B}$) для изготовления эффективных солнечных элементов [1–5], а твердые растворы ${\rm CuIn(Te,Se)_2}$ (CITS) кроме применения их в качестве поглощающих слоев могут использоваться как промежуточные слои для улучшения механических и оптических свойств структуры ${\rm Mo/CuInSe_2}$ [6]. Представляет значительный интерес исследование физических свойств тонких пленок CITS, в частности их оптических характеристик, природы энергетических переходов в них вблизи фундаментального края поглощения. В литературе практически отсутствуют сведения об исследовании оптических свойств тонких пленок CITS в связи с трудностью получения стехиометриченых слоев традиционными методами напыления.

Ранее нами сообщалось о получении стехиометричных тонких пленок CuInSe₂, CuInTe₂ и CuIn($Te_{0.15}Se_{0.85}$)₂ импульсным лазерным напылением и исследовании структуры краевого поглощения в них [7–10]. В настоящей работе приводятся результаты исследования спектральной зависимости краевого поглощения стехиометричных (по результатам

анализа спектров обратного резерфордовского рассеяния с точностью до 2%) халькопиритных тонких пленок $\mathrm{CuIn}(\mathrm{Te}_x\mathrm{Se}_{1-x})_2$ ($0\leqslant x\leqslant 1$), полученных методом импульсного лазерного испарения, подробно описанного ранее в $[7{-}10]$. Установлен характер зависимости переходов, связанных с прямыми разрешенными переходами электронов из валентной зоны в зону проводимости и переходами, обусловленными расщеплением валентной зоны под действием тетрагонального поля кристаллической решетки и спин-орбитального взаимодействия от состава твердых растворов СІТЅ.

Спектральное распределение коэффициента отражения R и пропускания T пленок CITS на стеклянных подложках измерялось при комнатной температуре в видимой и ближней инфракрасной области (500—1700 нм) на спектрофотометрах "Specord-61 NIR" и "Specord-UV-VIS". Для измерений использовалась стандартная приставка отражения с симметричным ходом лучей. Спектральное разрешение составляло ≈ 0.8 мэВ в видимой области спектра и 0.5 мэВ в ближней инфракрасной области. Погрешность измерения коэффициента отражения ΔR не превышала 2%. Толщина пленок составляла ≈ 0.6 мкм.

Оптические константы тонких пленок CITS определялись решением системы уравнений с испльзованием экспериментальных данных $R(\lambda)$ и $T(\lambda)$ и с учетом интерференции в системе пленка–подложка:

$$T_{14} = \frac{1 - R_{12}}{1 - R_{12}R_a^1} \cdot T_a,$$

$$R_{14} = \frac{R_{12}T_a^2}{1 - R_{12}R_a^1} + R_a.$$
(1)

Здесь $R_{12}=(n_2-1)^2/(n_2+1)^2$ — френелевский коэффициент отражения на границе пленка-воздух, $R_a=C/A$; $R_a^1=B/A$; $T_a=16n_3(n_2^2+k_2^2)/A$; T_{14} и R_{14} — измеренные коэффициенты пропускания и отражения системы пленка-подложка:

$$A = \rho \tau \exp(\gamma k_2) + \delta \sigma \exp(-\gamma k_2) + 2S \cos(n_2 \gamma) + 2t \sin(n_2 \gamma),$$

$$B = \rho \sigma \exp(\gamma k_2) + \delta \tau \exp(-\gamma k_2) + 2q \cos(n_2 \gamma) - 2r \sin(n_2 \gamma),$$

$$C = \tau \sigma \exp(\gamma k_2) + \sigma \rho \exp(-\gamma k_2) + 2q \cos(n_2 \gamma) + 2r \sin(n_2 \gamma),$$

Письма в ЖТФ. 1997. том 23. № 12

$$\sigma = (n_2 - n_3)^2 + k_2^2, \qquad \rho = (n_2 + 1)^2 + k_2^2,$$

$$\tau = (n_2 + n_3)^2 + k_2^2, \qquad r = 2k_2(n_3 - 1)(n_2^2 + k_2^2 + n_3),$$

$$\delta = (n_2 - 1)^2 + k_2^2, \qquad t = 2k_2(n_3 + 1)(n_2^2 + k_2^2 - n_3),$$

$$S = (n_2^2 + k_2^2)(n_3^2 + 1) - (n_2^2 + k_2^2)^2 - n_3^2 + 4n_3k_2^2,$$

$$q = (n_2^2 + k_2^2)(n_3^2 + 1) - (n_2^2 + k_2^2)^2 - n_3^2 - 4n_3k_2^2,$$

$$\gamma = 4\pi d_2/\lambda.$$

Решение системы уравнений (1) находилось итерационными методами. Предполагалось, что показатель преломления исходной (n_1) и конечной фаз (n_4) равен единице, а показатель преломления подложки

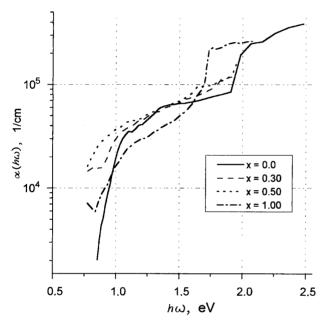


Рис. 1. Спектральная зависимость коэффициента поглощения тонких слоев $CuIn(Te_xSe_{1-x})_2$.

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 12

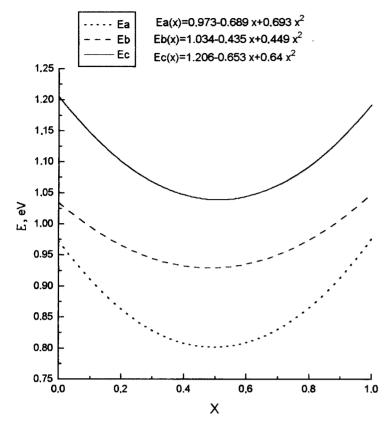


Рис. 2. Концентрационные зависимости переходов E_A , E_B и E_C .

 $n_3=1.5\pm0.01$. Точность в определении n_2 и k_2 составляла ±0.001 . Коэффициент поглощения lpha определялся из выражения $lpha=2\pi k/\lambda$.

Анализ полученных зависимостей $\alpha(h\omega)$ для пленок СІТS (рис. 1) согласно квазикубической модели p-d гибридизации валентных зон в халькопиритных соединениях [11] показал, что существенный вклад в структуру краевого поглощения пленок СІТS вносят прямые разрешенные переходы, определенные из соотношений $(\alpha h\omega)^2 = A_n^2(h\omega - E_{gn})$ в различных энергетических интервалах: E_A — переход валентная зона—

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 12

зона проводимости $(\Gamma_7^v - \Gamma_6^c)$; $E_{\rm B}$ — переход, обусловленный расщеплением валентной зоны под действием тетрагонального поля кристаллической решетки $(\Gamma_6^v - \Gamma_6^c)$; E_c — переход, связанный со спин-орбитальным расщеплением валентной зоны $(\Gamma_7^v - \Gamma_6^c)$. Концентрационные зависимости, полученные для пленок СІТЅ переходов E_A , E_B , E_C , имеют нелинейный вид с минимумом для эквимолярного состава твердого раствора (рис. 2) и описываются квадратичными уравнениями:

$$E_A(x) = 0.973 - 0.689x + 0.693x^2;$$

 $E_B(x) = 1.034 - 0.436x + 0.449x^2;$
 $E_C(x) = 1.206 - 0.653x + 0.64x^2.$

Параметры нелинейности C_A , C_B и C_C составляют соответственно 0.693, 0.449 и 0.64 и для пленок CITS определены впервые. Можно предположить, что нелинейный характер зависимостей E_A , E_B , E_C от состава твердых растворов CITS связан с нелинейными свойствами кристаллического поля твердых растворов, однако это требует проведения дополнительных исследований методом псевдопотенциала. Необходимо отметить, что вид зависимости E_A от состава твердых растворов с минимумом при x=0.5 для пленок хорошо совпадает с данными работы [12] для кристаллов CITS.

В заключение необходимо отметить, что сложная структура краевого поглощения в тонких пленках CITS идентифицирована в данной работе впервые.

Авторы выражают благодарность В.Ф. Гременку и И.А. Викторову за изготовление пленок и определение их состава.

Работа финансируется Фондом фундаментальных исследований Беларуси (грант № Φ 94-289).

Список литературы

- [1] Современные проблемы полупроводниковой фотоэнергетики / Под ред. Т. Каутса. М.: Мир, 1988. 307 с.
- [2] Diaz R., Leon M., Rueda F. // Jap.J. Appl. Phys. 1992. V. 31. P. 3675–3679.
- [3] Neumann H., Perlt B., Horig, Kuh N.G. // Thin Solid Films. 1989. V. 182. P. 115–119.

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 12

- [4] Hedstrom J., Ohlsen H., Bodegard M. et al. // 23d IEEE Photovol. Spec. Conf. Lousville. 1993. P. 364.
- [5] Yamaguchi T., Matsufusa J., Yoshida A. // Jpn. J. Appl. Phys. 1992. V.31.L703– L705.
- [6] Basol B.M., Kapur V.K., Halani A., Leidholm C. // Solar Energy Materials and Solar Cells. 1993. V. 29. P. 163–167.
- [7] Kindyak V.V., Kindyak A.S., Gremenok V.F. et al. // Thin Solid Films. 1994. V250. P. 33–36.
- [8] Киндяк В.В., Киндяк А.С., Гременюк В.Ф. и др. // Письма в ЖТФ. 1995. Т. 21. В. 7. С. 60–64.
- [9] Kindyak A.S., Kindyak V.V., Hill A.E. et al. // Cryst. Res. Technol. 1996. V. 31S. P. 193–196.
- [10] Киндяк В.В., Киндяк А.С., Латушко Я.И. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. В. 14. С. 90–94.
- [11] Shay J.L., Tell B., Kasper H.M., Shiavone L.M. // Phys. Rev. 1972. V. B5. P 5003
- [12] *Боднарь И.В., Забелина И.А.* // Журн. прикл. спектроскоп., 1994. Т. 60. № 3–4. С. 320–323.
- [13] *Чалдышев В.А., Караваев Г.Ф.* // Изв. вузов. Сер. физ. 1963. № 5. С. 103–112.